

## SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA

## FORMULÁRIO PARA A REPRODUÇÃO DE RESUMO DE TRABALHO

Informar que equipamento

audiovisual irá necessitar

Informar se o trabalho será apresentado

em Sessão de

	Painéis  Comunicação Oral	Projetor de slides Retroprojetor
era uso da Secretaria) IMPORTANTE Leia tod	das as INSTRUCÕES antes de datllografar o RESUMO.	
	CENTRAÇÃO DE PORTADORES EM FILMES SEMI tari, E. Manzoli, B. Sharappe e M. Siu	
Filmes semicondutores cular (MBE), com espessuras de 1 a a presença de concentração de porta lo-se apenas a temperatura da célul crato mantida a 600°C. Uma das amo	de GaAs:SI / GaAs foram crescidos por 2 μ. Medidas de efeito Hall e condutiv dores na faixa de 10 <sup>18</sup> a 10 <sup>15</sup> cm <sup>-3</sup> . Is a de efusão do Si (1300° - 1000°C), co stras apresenta concentração de por peratura de 77 K. Acompanhando a morfo de nosso sistema de MBE.	vidade elétrica indicara sto foi conseguido varian om a temperatura do subs stadores de 10 <sup>18</sup> cm <sup>-3</sup> e um
 41a. Reunião Anual	COMPROVANTE DE ACEITAÇÃO DE	RESUMO
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência  D.1.4.	Artemos M. Ceschin, Airton C. No Autor(es) — nome por extenso Bruno Sharappe e Máximo Siu Li	
Seção (consulte instruções)	Título do trabalho	oncentração de portadores
	em filmes semicondutores GaAs:S	crescidos por MBE
	Secretaria	da SBPC
A1a. Reunião Anual Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência  D.1.4  Indique letra e número da Seção (consulte instruções)	COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE RESUMO	
	Artemis M. Ceschin, Airton C. Notari, Eduardo Manzoli,  Autor(es) — nome por extenso  Bruno Sharappe e Máximo Siu Li	
	Título do trabalho. Mobilidade Hall e concentração de portadores	
	em filmes semicondutores GaAs:Si	crescidos por MBE
	Secretaria	da SBPC

Ciencia , Culturo. Supl., 41 (7): 285, gul. 1989

ØØØØ1139.

Campo	Dado	
****	Documento 1 de 1	
No. Registro	000791741	
Tipo de material	TRABALHO DE EVENTO-RESUMO PERIODICO - NACIONAL	
Entrada Principal	Ceschin, A M (*)	
Título	Mobilidade hall e concentracao de portadores em filmes semicondutores 'GA"AS' : 'SI' crescidos por mbe.	
Imprenta	São Paulo, 1989.	
Descrição	p.285.	
Autor Secundário	Notari, A C (*)	
Autor Secundário	Manzoli, E (*)	
Autor Secundário	Sharappe, B (*)	
Autor Secundário	Siu Li, Máximo	
Autor Secundário	Reunião Anual da SBPC (41. 1989 Fortaleza)	
Fonte	Ciência e Cultura, São Paulo, v.41, n.7 supl., p.285, jul. 1989	
Unidade USP	IFQSC-F INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS	
Localização	IFSC PROD001139	